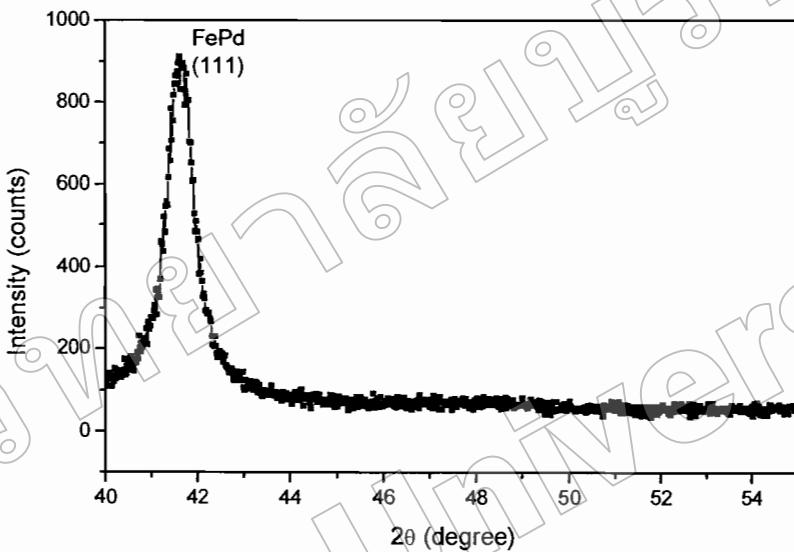


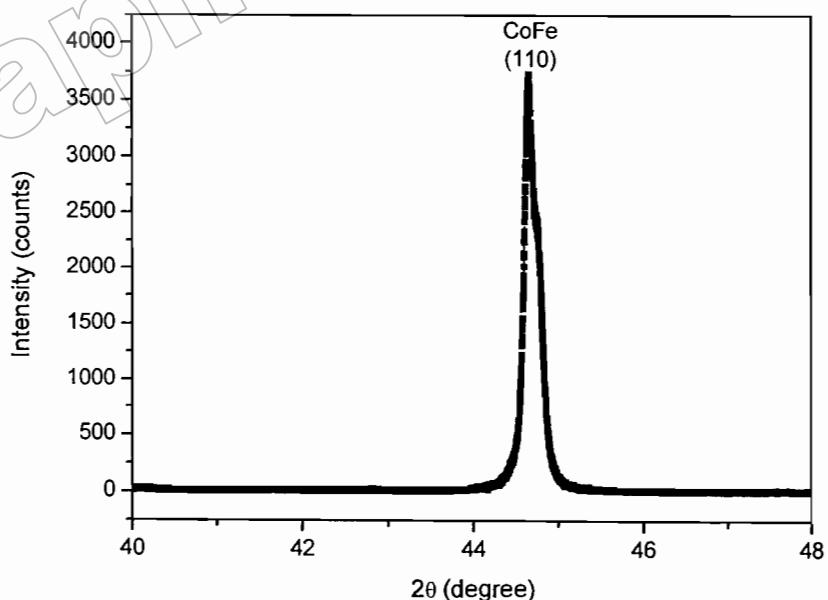
บทที่ 4

ผลการวิจัย

4.1 ลักษณะทางโครงสร้างและสมบัติทางแม่เหล็กของฟิล์มตัวอย่างที่เตรียมได้

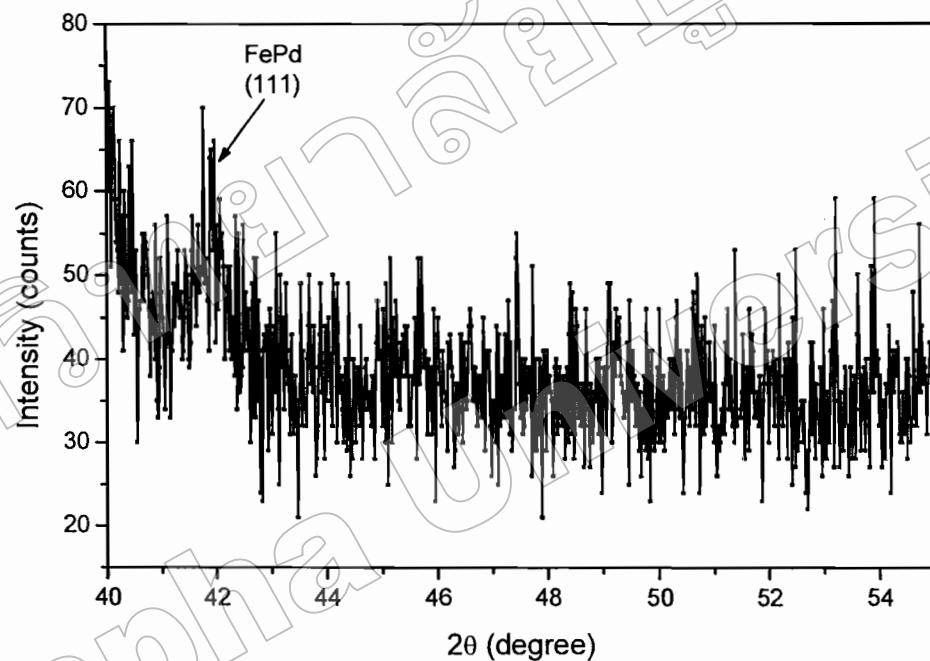


ภาพที่ 37 แสดงผลการวิเคราะห์ XRD ของฟิล์มตัวอย่าง FePd(30 nm) ที่เตรียมได้



ภาพที่ 38 แสดงผลการวิเคราะห์ XRD ของฟิล์มตัวอย่าง CoFe(16 nm) ที่เตรียมได้

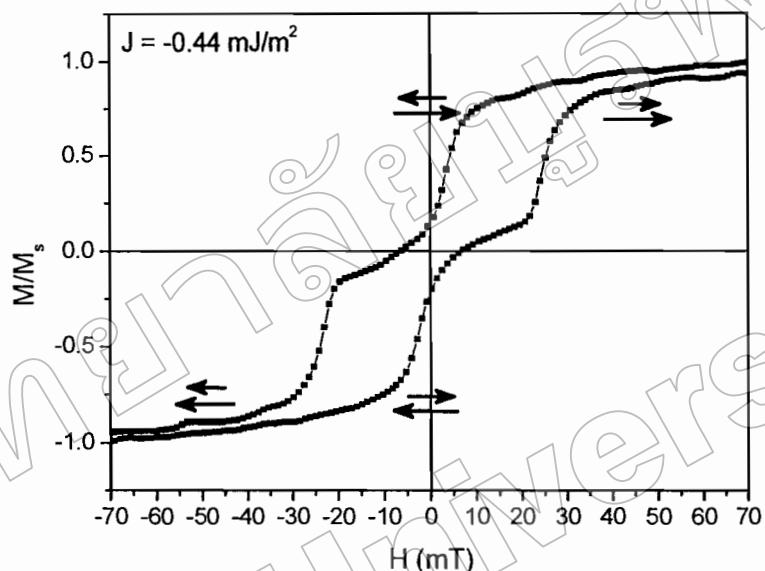
จากผลการวิเคราะห์ XRD ของฟิล์มตัวอย่างแบบชั้นเดียว FePd(30 nm) พบว่า ณ สถานะการเตรียมที่อุณหภูมิห้อง โลหะผสม FePd มีโครงสร้างแบบ A1 โดยสังเกตได้จากพีคของระนาบ 111 ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนที่ $2\theta = 41.6^\circ$ และดังภาพที่ 37 ในส่วนของฟิล์มตัวอย่างแบบชั้นเดียว CoFe(16 nm) ที่เตรียมได้ที่อุณหภูมิห้องนั้น พบว่า ผลการวิเคราะห์ XRD ในภาพที่ 38 แสดงให้เห็นถึงพีคของระนาบ 110 เกิดขึ้นอย่างชัดเจนที่ $2\theta = 44.6^\circ$ ซึ่งบ่งบอกถึงการเกิดโครงสร้างแบบ B2 ในฟิล์มตัวอย่างดังกล่าว



ภาพที่ 39 แสดงผลการวิเคราะห์ XRD ของฟิล์มตัวอย่าง FePd(30 nm)/Ru(0.8 nm)/CoFe(16 nm) ที่เตรียมได้

ในการศึกษาโครงสร้างของฟิล์มแบบ 3 ชั้น FePd(30 nm)/Ru(0.8 nm)/CoFe(16 nm) ที่เตรียมได้ พบว่า ลักษณะพีคของผลการวิเคราะห์ XRD ในภาพที่ 39 มีสัญญาณรบกวนเป็นจำนวนมาก มากทำให้ยากต่อระบุตำแหน่งของพีค สัญญาณรบกวนดังกล่าวเกิดจากความบกพร่องในโครงสร้างของฟิล์มแม่เหล็ก FePd/Ru/CoFe เนื่องจากฟิล์มแต่ละชั้นที่นำมาเคลือบมีโครงสร้างแตกต่างกัน คือ FePd มีโครงสร้างแบบ A1, Ru มีโครงสร้างแบบ A3 (hexagonal close-packed; hcp) และ CoFe มีโครงสร้างแบบ B2 ลักษณะนี้เมื่อทำการเคลือบฟิล์ม อะตอมของฟิล์มในแต่ละชั้นจะมีจัดการจัดเรียงตัวของโครงสร้างหลักที่ค่อนข้างไม่สมบูรณ์ โดยเกิดความไม่ต่อเนื่องของเนื้อฟิล์มบริเวณรอยต่อ

(Interface roughness) ระหว่างฟิล์มแต่ละชั้น จากการวิเคราะห์ XRD ของฟิล์มตัวอย่าง ดังกล่าว พบว่า พิคของ FePd ที่มีโครงสร้างแบบ A1 ปรากฏขึ้นที่ 2θ มีค่าประมาณ 42° องศา และ พิคของ CoFe ซึ่งมีโครงสร้างแบบ B2 และพิคของ Ru ที่มีโครงสร้างแบบ A3 นั้น ไม่สามารถระบุตำแหน่งได้อย่างชัดเจน



ภาพที่ 40 แสดง wang ชิสเทอร์ซิสที่มีการจ่ายสนามแม่เหล็กในทิศทางกับระนาบของ ฟิล์มตัวอย่างแบบ 3 ชั้น FePd(30 nm)/Ru(0.8 nm)/CoFe(12 nm) ที่เตรียม ณ อุณหภูมิห้องก่อนผ่านการอบความร้อน

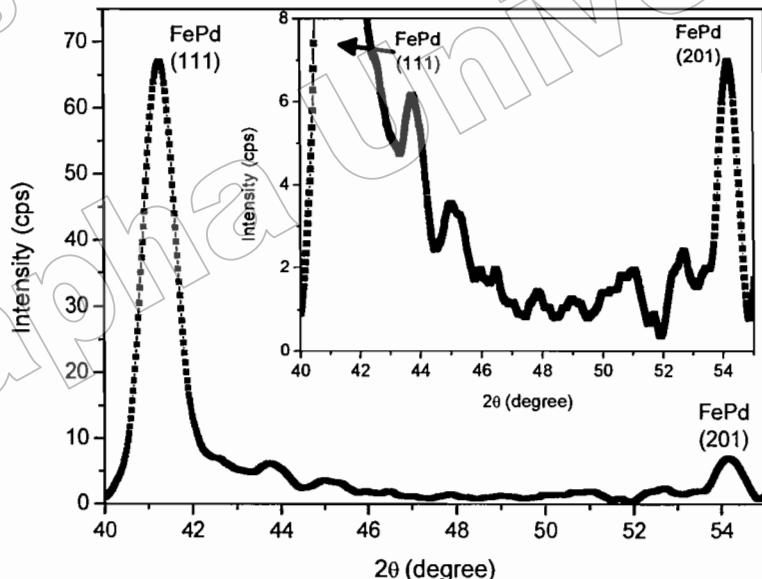
จากการวิเคราะห์สมบัติทางแม่เหล็กด้วย VSM ของ ฟิล์มแบบ 3 ชั้น FePd/Ru/CoFe ที่ เตรียม ณ อุณหภูมิห้อง พบว่า ฟิล์มตัวอย่าง FePd(30 nm)/Ru(0.8 nm)/CoFe(12 nm) แสดงการเกิด อันตรกิริยาแบบ AFC ได้เด่นชัดที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับฟิล์มตัวอย่างแบบ 3 ชั้นอื่น ๆ โดยสังเกต ได้จาก wang ชิสเทอร์ซิสที่ปรากฏอย่างมีนัยสำคัญขึ้นบันได ดังแสดงในภาพที่ 40 จากผลงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่า ที่สภาวะการเตรียมที่อุณหภูมิห้อง โลหะผสม FePd มีค่า H_c ที่ต่ำกว่า CoFe (Chen et al., 2006; Chen & Nikles, 2002; Issro et al., 2005) ทำให้ชั้นฟิล์ม FePd แสดงสมบัติเป็นชั้นแม่เหล็ก ชนิดอ่อน และชั้นฟิล์ม CoFe แสดงสมบัติเป็นชั้นแม่เหล็กชนิดแข็งของการเกิดอันตรกิริยาแบบ AFC การอธิบายพฤติกรรมการเกิดอันตรกิริยาแบบ AFC จากร Wang ชิสเทอร์ซิสในภาพที่ 40 นั้น ทางผู้วิจัยได้กำหนดสัญลักษณ์ลูกศรสั้นและลูกศรยาวแทนการจัดวางตัวของแมgnite ได้ เช่น ชั้น FePd (M_1) และชั้น CoFe (M_2) ตามลำดับ ขณะที่สนามแม่เหล็กจากภายนอกจ่ายให้กับฟิล์ม

ตัวอย่างมีค่าประมาณ 55 mT นั้น อันตรกิริยาแบบ AFC จะถูกทำให้หมุดกำลังลง แมgnิติเดชันของชั้น FePd และ CoFe จะบันทึกและมีพิศทางเดียวกับพิศของ H ทำให้แมgnิติเดชันรวมของฟิล์มตัวอย่างมีค่าอิ่มตัว และเรียงสนามแมgnิเต็ดที่ให้จากภายนอกแล้วทำให้ฟิล์มตัวอย่างมีแมgnิติเดชันอิ่มตัวว่าค่าสนามแมgnิเตดอิ่มตัว (Saturation field; H_s) ต่ำมาเมื่อลดค่า H ลงไปจนถึงค่า Exchange field ของชั้น FePd (H_{ex1}) พบว่า ค่าแมgnิติเดชันรวมของชั้นงานตัวอย่างลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเกิดจากการสลับพิศทางของ M_1 ไปในพิศที่ตรงกันข้ามกับพิศของ M_2 และ H อย่างทันทัน การสลับพิศทางของ M_1 ดังกล่าวเกิดจากการเหนี่ยวนำของอันตรกิริยาแบบ AFC ที่เกิดขึ้นระหว่างชั้น FePd และ CoFe โดยที่ค่า H_{ex1} สามารถหาได้จาก $J/M_{s1}t_1$ (Fullerton et al., 2000, p. 3807) เมื่อ M_{s1} และ t_1 คือค่าแมgnิติเดชันอิ่มตัว (Saturation magnetizaton) และความหนาของชั้น FePd ตามลำดับ ต่ำมาเมื่อทำการลดสนาม H ที่ให้กับชั้นงานตัวอย่างไปที่ 0 mT พบว่า M_1 และ M_2 ยังคงมีพิศทางส่วนทางกันเนื่องจากอันตรกิริยาแบบ AFC และเมื่อทำการจ่ายสนาม H ใหม่พิศที่ตรงกันข้ามกับพิศทางเดิมไปจนถึงค่า Exchange field ของชั้น CoFe ($H_{ex2} \approx J/M_{s2}t_2$) พบว่า M_2 จะมีการสลับพิศทางไปจากเดิมทำให้มีพิศทางเดียวกันกับ M_1 ซึ่งสังเกตได้จากการที่ค่าแมgnิติเดชันรวมของชั้นงานมีค่าเพิ่มขึ้นในทางลบอย่างรวดเร็ว และจะเริ่มนิ่ำลงที่ H มีค่าประมาณ -55 mT หลังจากนั้น เมื่อทำการลดสนาม H กลับไปที่ 0 mT และจ่าย H ไปในพิศทางเดิมจนมีค่าถึง 55 mT อีกครั้ง พบว่าจะชิสเทอริซิสที่ได้จากการวิเคราะห์มีลักษณะคล้ายกับขั้นบันได ซึ่งบ่งบอกถึงการเกิดอันตรกิริยาแบบ AFC ขึ้นในชั้นงานดังกล่าว โดยสามารถคำนวณหาค่า J ของอันตรกิริยาแบบ AFC ที่เกิดขึ้น จากสมการที่ (1) ได้เท่ากับ -0.44 mJ/m^2

การเกิดอันตรกิริยาขึ้นในฟิล์มตัวอย่าง FePd(30 nm)/Ru(0.8 nm)/CoFe(12 nm) สามารถอธิบายได้ในเชิงทฤษฎีโดยอาศัยประการปฏิกิริยาที่อิเล็กตรอนถูกกักอยู่ในป่าศักย์แบบควบคุมในชั้น NM ที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 2.2 ซึ่งอธิบายได้ว่า สภาพที่แมgnิติเดชันของชั้น FePd และ CoFe มีพิศทางเดียวกัน (เกิดอันตรกิริยาแบบ FC) นั้น ไม่เหมาะสมต่อการปราศจากขึ้นในฟิล์มตัวอย่างที่เตรียมได้ เนื่องจากความหนา 0.8 nm ของชั้น Ru เป็นค่าความหนาที่จะทำให้เกิดการแบ่งระดับชั้น พลังงานของอิเล็กตรอนที่ถูกกักอยู่ในชั้น Ru และมีการสั่นพ้องของคลื่นอิเล็กตรอนขึ้นบริเวณระดับชั้น E_F ส่งผลให้พลังงานรวมของระบบ QW ในชั้น Ru มีค่าสูงกว่าระดับ E_F ของอิเล็กตรอน และทำให้โครงสร้างของอิเล็กตรอนในชั้นวัสดุ Ru เกิดความไม่เสถียร ระบบ QW จึงทำการปรับเปลี่ยนให้แมgnิติเดชันของชั้น FePd ซึ่งเป็นชั้นแมgnิเต็ดที่มีพิศที่ส่วนทางกับชั้นของ CoFe ซึ่งเป็นสภาพที่ระบบมีพลังงานที่ต่ำและมีความเสถียร ส่งผลให้อันตรกิริยาแบบ AFC ปราศจากขึ้นในฟิล์มตัวอย่าง FePd(30 nm)/Ru(0.8 nm)/CoFe(12 nm) ที่เตรียมได้

คอลสงของค่า ρ_0 นั้น เกิดจากการที่พลังงานความร้อนกระดิ่นให้อะตอมในฟิล์มตัวอย่าง FePd(30 nm)/Ru(0.8 nm)/CoFe(x nm) มีการเคลื่อนที่และจัดเรียงตัวใหม่ เพื่อลดความนกร่วงของโครงร่างผลึกในชั้นฟิล์มทั้ง 3 ชั้น และทำให้อะตอมของชั้น FePd เกิดความเป็นระเบียบช่วงยาว (Long range order; LRO) โดยที่ ρ_0 และค่าระดับของการเกิดระเบียบช่วงยาว (Degree of LRO; S) จะมีความสัมพันธ์อยู่ในรูปของ $\rho_0 \propto (1 - S^2)$ (Issro et al., 2005, p. 449) ซึ่งสามารถอธิบายได้ ดังนี้ จากการที่อิเล็กตรอนตัวนำที่ผ่านเข้าไปในชั้นงานตัวอย่างมีการกระเจิงที่ลดลง เนื่องจาก อะตอมในชั้นฟิล์ม FePd มีการจัดเรียงตัวที่เป็นระเบียบมากขึ้น ทำให้สภาพด้านหน้าไฟฟ้าในฟิล์ม ตัวอย่างมีค่าลดลงเมื่ออุณหภูมิที่ใช้ในการอบความร้อนเพิ่มขึ้น การเคลื่อนย้ายของอะตอมดังกล่าว ส่งผลให้ชั้นของ FePd เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างจากโครงสร้างแบบ A1 ไปเป็นแบบ L1₀

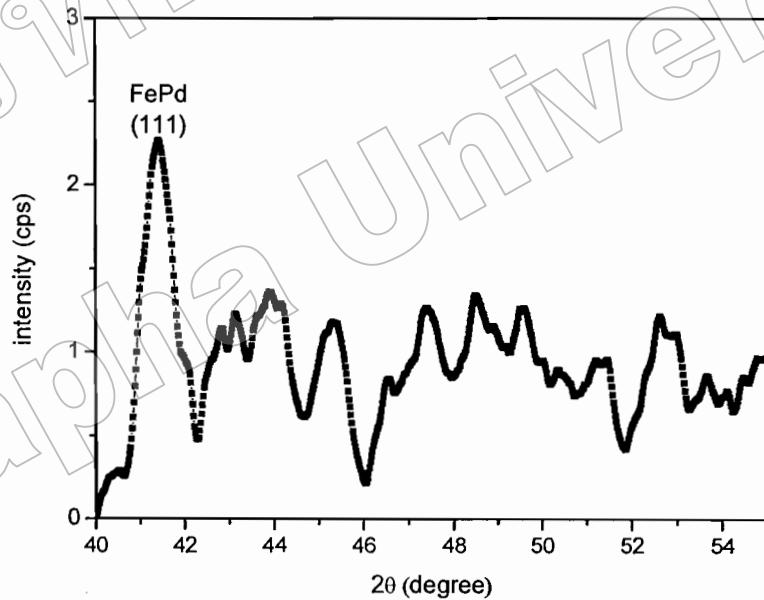
4.3 ลักษณะทางโครงสร้างและสมบัติทางแม่เหล็กของฟิล์มตัวอย่างที่ผ่านการอบความร้อนแบบไอโซโกรนัค



ภาพที่ 42 แสดงผลการวิเคราะห์ XRD ของฟิล์มตัวอย่างแบบชั้นเดียว FePd(30 nm) ที่ผ่านการอบความร้อนไปจนถึงอุณหภูมิ 813 K

การเคลื่อนที่และการจัดระเบียบของอะตอมในชั้นฟิล์ม FePd เมื่อจากพลังงานความร้อนส่งผลให้ชั้นฟิล์มดังกล่าวเกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างจากโครงสร้างแบบ A1 ไปเป็น

แบบ $L1_0$ โดยสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ลักษณะทางโครงสร้างด้วย XRD ของฟิล์มตัวอย่างแบบชั้นเดียว FePd ที่ผ่านการอบความร้อนไปจนถึงอุณหภูมิ 813 K แสดงคังภาพที่ 42 พบว่า พีคของรูนา 111 ของโลหะผสม FePd ปรากฏอยู่ที่ตำแหน่ง 2θ มีค่าประมาณ 41.4° และในขณะเดียวกันที่ 2θ มีค่าประมาณ 54.2° นั้น ปรากฏพีคของรูนา 201 ซึ่งเป็นพีคแบบ Superstructure ของโลหะผสม FePd ที่มีโครงสร้างแบบ $L1_0$ ขึ้น และเมื่อพิจารณาภาพขยายของผลการวิเคราะห์ดังกล่าวในภาพที่ 42 พบว่า มีพีคความเข้มต่ำปรากฏขึ้นเป็นจำนวนมากในตำแหน่งที่ 2θ มีค่าอยู่ในช่วง $43 - 53^\circ$ โดยบางส่วนของพีคเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการเกิดออกไซด์ของ Fe เนื่องจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน ในส่วนของโลหะผสม CoFe นั้น เนื่องจากมีอุณหภูมิของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอยู่ที่ประมาณ 1000 K (Kogachi et al., 2005 p. 536; Kubaschewski, 1982, p. 28) ดังนั้น โลหะผสมดังกล่าวจึงมีโครงสร้างแบบ B2 เช่นเดิม และมีโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างเนื่องจากกระบวนการให้ความร้อนในงานวิจัยนี้น้อยมาก

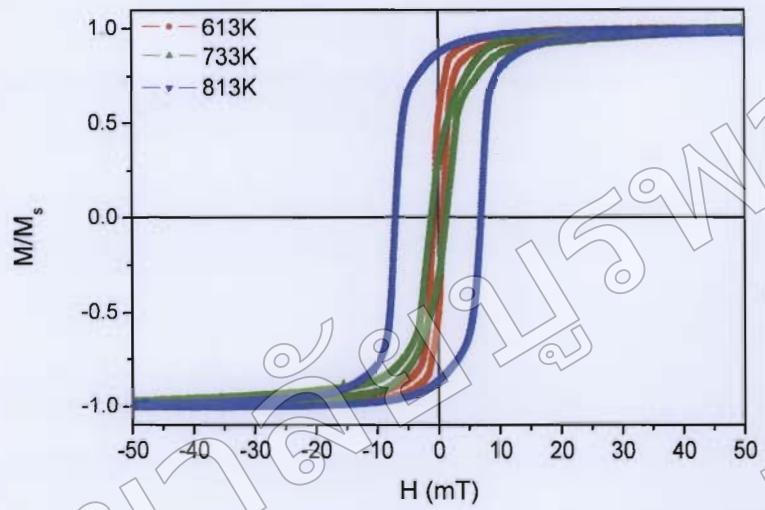


ภาพที่ 43 แสดงผลการวิเคราะห์ XRD ของฟิล์มตัวอย่างแบบ 3 ชั้น FePd(30 nm)/Ru(0.8 nm)/CoFe(16 nm) ที่ผ่านการอบความร้อนไปจนถึงอุณหภูมิ 813 K

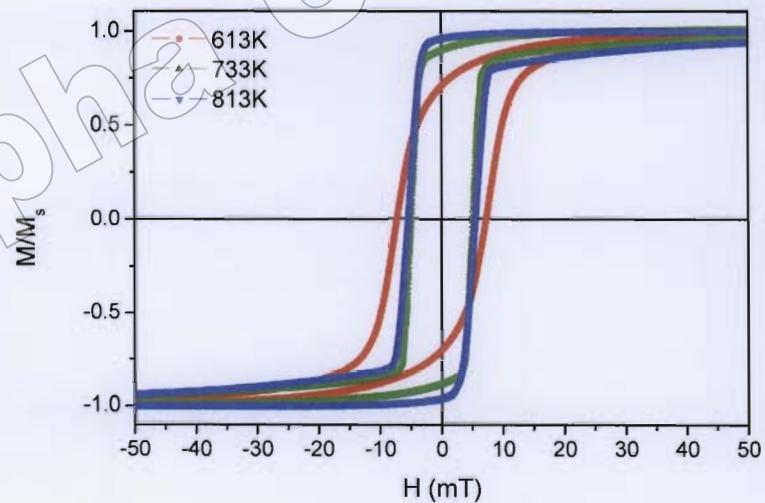
จากผลการวิเคราะห์โครงสร้างของฟิล์มแบบ 3 ชั้น FePd(30 nm)/Ru(0.8 nm)/CoFe(16 nm) ที่ผ่านการให้ความร้อนไปจนถึงอุณหภูมิ 813 K ในภาพที่ 43 พบว่า ลักษณะพีคของ XRD ที่เกิดขึ้นมีสัญญาณรบกวนเป็นจำนวนมากทำให้ยากต่อระบุตำแหน่งของพีค เช่นเดียวกับฟิล์มตัวอย่าง FePd/Ru/CoFe ที่เตรียมได้ที่สภาพอุณหภูมิห้อง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการบกร่องใน

โครงสร้างของฟิล์มตัวอย่างดังกล่าว เนื่องจากฟิล์มแต่ละชั้นมีโครงสร้างแตกต่างกัน โดยพีคของ FePd ที่มีโครงสร้างแบบ A1 มีการปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด ที่ 2θ มีค่าประมาณ 41.4° องศา แต่ พีคของ FePd ที่มีโครงสร้างแบบ L₁, พีคของ CoFe ซึ่งมีโครงสร้างแบบ B2 และพีคของ Ru ที่มีโครงสร้างแบบ A3 นั้น ไม่สามารถระบุตำแหน่งได้อย่างชัดเจน

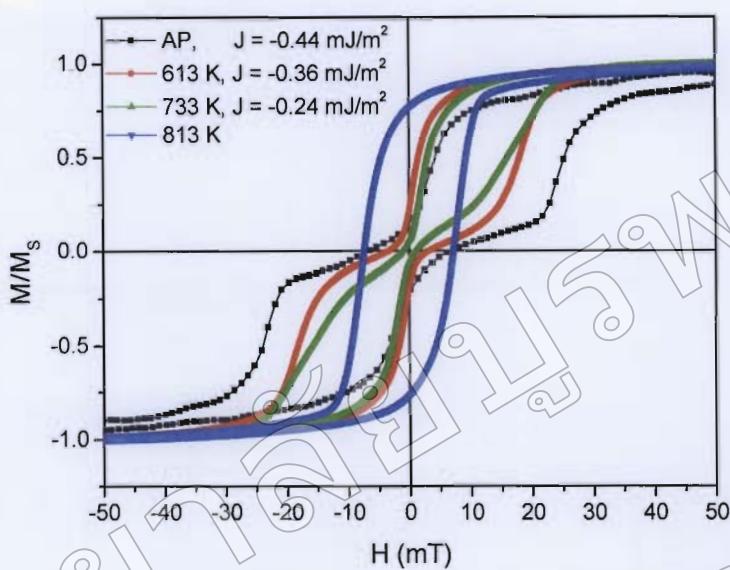
การเปลี่ยนแปลงทาง โครงสร้างของ โลหะผสม FePd จาก โครงสร้างแบบ A1 ไปเป็น แบบ L₁ ทำให้แกน c ในโครงร่างผลึกมีการหดสั้นลงจากเดิม และเป็นพิศทางที่สามารถแมกนีติก ได้จ่าย (Easy axis) ส่งผลให้โลหะผสมดังกล่าวมีค่า K_u เพิ่มขึ้นและมีสมบัติทางแม่เหล็กแบบ เพอร์โตรานิตเดี่ยวที่สูงขึ้น โดยสังเกตได้จากค่า H_C ที่เพิ่มขึ้น ($H_C \sim 2K_u/M_s$) ในวงจรไฮบริดิกที่ ได้จากการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง AGFM ซึ่งจ่ายสนามแม่เหล็กเข้าไปในทิศที่ขานกับระนาบของ ฟิล์มตัวอย่างแบบชั้นเดียว FePd(30 nm) ที่ผ่านการอบความร้อนไปจนถึงอุณหภูมิ 613, 733 และ 813 K ดังแสดงในภาพที่ 44 จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวพบว่า ค่า H_C ของฟิล์มตัวอย่างมีค่าเพิ่มขึ้น เล็กน้อย จากการอบความร้อนที่สภาวะอุณหภูมิ 613 K ไปเป็น 733 K เมื่อจากการเกิดระเบียบของ อะตอมในโครงร่างผลึกเริ่มเกิดขึ้น แต่เมื่อให้ความร้อนไปจนถึงอุณหภูมิ 813 K นั้น ค่า H_C จะเพิ่ม สูงขึ้นมาก เนื่องจากพลังงานความร้อนมีค่าสูงพอ ทำให้การเกิดระเบียบของอะตอมของโครงสร้าง แบบ L₁ มีมากขึ้น จากรายละเอียดของฟิล์มตัวอย่างแบบชั้นเดียว CoFe ซึ่งแสดงดังภาพที่ 45 พบว่า ฟิล์มตัวอย่างดังกล่าวมีสมบัติทางแม่เหล็กแบบเพอร์โตร์ที่อ่อนลงเล็กน้อยเมื่ออุณหภูมิที่ใช้ในการอบความร้อนเพิ่มขึ้นจาก 613 K เป็น 733 K มีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนตำแหน่งของการเรียงตัว ของอะตอมบางอะตอมในโครงผลึกเนื่องจากถูกกระตุ้นด้วยความร้อน แต่โลหะผสมดังกล่าวยังคง มีโครงสร้างแบบ B2 เช่นเดิมแม้ว่าจะให้ความร้อนไปจนถึงอุณหภูมิ 813 K ก็ตาม ส่งผลให้ค่า H_C ของโลหะผสม CoFe ที่ผ่านกระบวนการให้ความร้อนไปที่อุณหภูมิต่าง ๆ ในงานวิจัยนี้มีค่า ใกล้เคียงกัน



ภาพที่ 44 แสดงวงซิสเทอเรชิสที่มีการจ่ายสนามแม่เหล็กในทิศวนานกับระดับของฟิล์มตัวอย่าง FePd(30 nm) ที่ผ่านการอบความร้อนจนถึงอุณหภูมิ 613, 733 และ 813 K



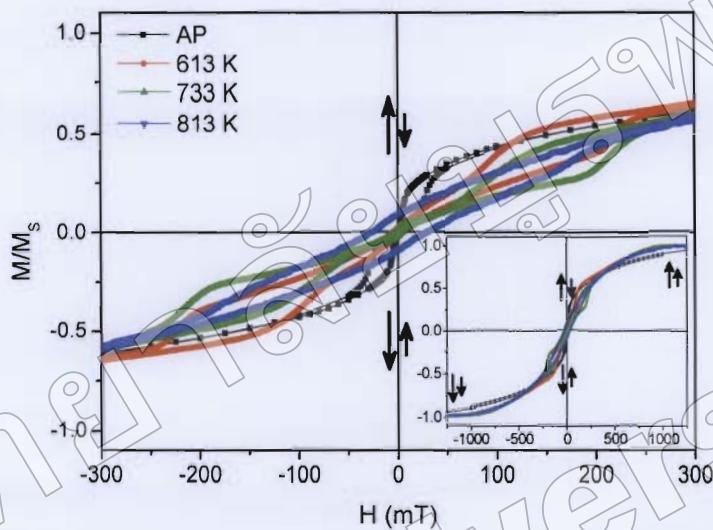
ภาพที่ 45 แสดงวงซิสเทอเรชิสที่มีการจ่ายสนามแม่เหล็กในทิศวนานกับระดับของฟิล์มตัวอย่าง CoFe(16 nm) ที่ผ่านการอบความร้อนจนถึงอุณหภูมิ 613, 733 และ 813 K



ภาพที่ 46 แสดงวงจรเทอร์เชสที่มีการจ่ายสนามแม่เหล็กในทิศนานาทิศที่มีผลต่อค่าคงที่ของพิล์ม
ตัวอย่างแบบ 3 ชั้น FePd(30 nm)/Ru(0.8 nm)/CoFe(12 nm) ที่เตรียมได้ (AP) และที่ผ่านการอบความร้อนไปจนถึงอุณหภูมิ 613, 733 และ 813 K

จากอันตรกิริยาแบบ AFC ที่เกิดขึ้นอย่างเด่นชัดในการผลิตของฟิล์มตัวอย่างแบบ 3 ชั้น FePd(30 nm)/Ru(0.8 nm)/CoFe(12 nm) ที่เตรียมได้ดีนั้น ผู้ทำวิจัยจึงได้เลือกชั้นงานดังกล่าวมาทำการศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิที่มีผลต่อสมบัติทางแม่เหล็ก ด้วยการวัดวง希สเทอริซิสที่มีการให้สนาณแม่เหล็กเข้าไปในทิศที่นานและตั้งฉากกับระนาบทองแผ่นฟิล์มตัวอย่าง โดย AGFM หลังจากที่นำฟิล์มตัวอย่างผ่านกระบวนการให้ความร้อนแบบไอโซโครนัลไปจนถึงอุณหภูมิ 613, 733 และ 813 K ตามลำดับ เมื่อพิจารณา wang ของ希สเทอริซิสที่มีการให้สนาณแม่เหล็กเข้าไปในทิศที่นาน กับระนาบทองแผ่นฟิล์มตัวอย่างในภาพที่ 46 พบว่า อันตรกิริยาแบบ AFC ยังคงมีการปรากฏขึ้นในฟิล์มตัวอย่างที่ผ่านการให้ความร้อนไปจนถึงอุณหภูมิ 613 และ 733 K โดยสังเกตได้จากลักษณะของวง希สเทอริซิสที่มีรอยหยักเสมือนขึ้นบนไค และมีค่า H_s อยู่ที่ประมาณ 45 mT (สำหรับฟิล์มตัวอย่างที่ผ่านการอบความร้อนจนถึงอุณหภูมิ 613 K) และ 30 mT (สำหรับฟิล์มตัวอย่างที่ผ่านการอบความร้อนจนถึงอุณหภูมิ 733 K) เมื่อนำ H_s ไปคำนวณหาค่า J ของอันตรกิริยาแบบ AFC ที่เกิดขึ้นโดยใช้สมการที่ (1) พบว่า J มีค่าเท่ากับ -0.36 mJ/m^2 (613 K) และ -0.24 mJ/m^2 (733 K) ตามลำดับ ซึ่งมีขนาดที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับค่า J ของฟิล์มตัวอย่างก่อนผ่านกระบวนการร้อน (-0.44 mJ/m^2) สำหรับฟิล์มตัวอย่างที่ผ่านการอบความร้อนไปจนถึงอุณหภูมิ 813 K นั้น พบว่า ไม่

ปรากฏอันตรกิริยาแบบ AFC ขึ้น แต่ฟิล์มตัวอย่างจะแสดงอันตรกิริยา FC แทน โดยที่แมgniti เซชั่นของชั้น FePd และ CoFe มีพิศทางเดียวกัน สังเกตได้จากการวิสเทอเรซิสที่มีความเรียบไม่ปรากฏ รอยหยักแบบขั้นบันได ดังในภาพที่ 46



ภาพที่ 47 แสดง wang hysteresis ที่มีการจ่ายสนามแม่เหล็กในทิศตั้งฉากกับระนาบของฟิล์มตัวอย่าง แบบ 3 ชั้น FePd(30 nm)/Ru(0.8 nm)/CoFe(12 nm) ที่เตรียมได้ (AP) และที่ผ่านการอบความร้อนไปจนถึงอุณหภูมิ 613, 733 และ 813 K

สำหรับ wang hysteresis ที่มีการจ่ายสนามแม่เหล็กในทิศตั้งฉากกับระนาบของแผ่นฟิล์มตัวอย่าง FePd(30 nm)/Ru(0.8 nm)/CoFe(12 nm) ที่แสดงในภาพที่ 47 พบว่า ค่อนข้างสอดคล้องกับ wang hysteresis ที่มีการจ่ายสนามแม่เหล็กในทิศนานา กับระนาบของแผ่นฟิล์ม โดยแสดงให้เห็นถึง การปรากฏอันตรกิริยาแบบ AFC ขึ้นในฟิล์มตัวอย่างที่เตรียมได้ และที่ผ่านการอบความร้อนไปจนถึงอุณหภูมิ 613 และ 733 K ซึ่งอันตรกิริยาแบบ AFC จะถูกนำไปเมื่อให้ความร้อนกับฟิล์มตัวอย่างไปจนถึงอุณหภูมิ 813 K แต่เมื่อพิจารณาค่า H_s จาก wang hysteresis ในภาพที่ 46 และ 47 พบว่า สนามแม่เหล็กที่จ่ายเพื่อทำให้แมgniti เซชั่นในฟิล์มตัวอย่าง FePd(12 nm)/Ru(0.8 nm)/CoFe(12 nm) มีการอึมตัวในทิศที่นานา กับระนาบของแผ่นฟิล์ม มีค่าที่ต่ำกว่ามาก เมื่อเปรียบเทียบ กับสนามแม่เหล็กที่ทำให้แมgniti เซชั่นเกิดการอึมตัวในทิศที่ตั้งฉากกับระนาบของแผ่นฟิล์ม ทำให้สามารถเข้าใจได้ว่า ที่สภาวะปราศจากสนามแม่เหล็กจากภายนอกนั้น ไม่มนต์แม่เหล็กของอะตอนโดยส่วนใหญ่ในฟิล์มตัวอย่างดังกล่าว มีการวางแผนตัวอยู่ในทิศที่นานา กับระนาบของแผ่นฟิล์ม

เมื่อพิจารณาของเสียงสีของฟิล์มตัวอย่างแบบชั้นเดียวในภาพที่ 44 และ 45 พบว่าที่ อุณหภูมิ 613 K และ 733 K นั้น ชั้นฟิล์ม FePd จะทำหน้าที่เป็นชั้นแม่เหล็กชนิดอ่อน และชั้นฟิล์ม CoFe จะทำหน้าที่เป็นชั้นแม่เหล็กชนิดแข็งของการเกิดอันตรกิริยาแบบ AFC ในฟิล์มตัวอย่าง FePd/(30 nm)/Ru/(0.8 nm)/CoFe(12 nm) เมื่อจากค่า H_c ของชั้น FePd ต่ำกว่าชั้น CoFe แต่ค่า H_c ของชั้นฟิล์มทั้งสองจะแตกต่างกันน้อยลงตามการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ เมื่อจากชั้น FePd มีสมบัติทางแม่เหล็กแบบเฟอร์โรชนิกแข็งที่สูงขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง สำหรับที่อุณหภูมิ 813 K นั้น พบว่า ชั้นฟิล์ม FePd จะมีค่า H_c สูงกว่าชั้นของ CoFe เดิมน้อย เมื่อจากชั้น FePd มีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างมาเป็นโครงสร้างแบบ L1₀ ทำให้ที่สภาวะดังกล่าว ชั้นฟิล์ม FePd จะทำหน้าที่เป็นชั้นแม่เหล็กชนิดแข็ง และชั้นฟิล์ม CoFe จะทำหน้าที่เป็นชั้นแม่เหล็กชนิดอ่อน

สำหรับขนาดของค่า J ที่ลดลงในฟิล์มตัวอย่าง FePd/(30 nm)/Ru/(0.8 nm)/CoFe(12 nm) หลังจากที่นำฟิล์มตัวอย่างดังกล่าวผ่านการอบความร้อนไปจนถึงอุณหภูมิ 613 K และ 733 K นั้น สาเหตุอาจเกิดจากการที่ชั้นฟิล์มของ FePd มีสมบัติทางแม่เหล็กแบบเฟอร์โรชนิกแข็งที่สูงขึ้น โดยสังเกตได้จากค่า H_c ที่เพิ่มขึ้น ทำให้ชั้นโลหะผสมดังกล่าวสามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงทิศทางของแมgnนิติไซเซชันจากการผลักดันของระบบ QW ที่เกิดการสั่นพองที่ระดับ E_F ในชั้น Ru ได้นอก ขึ้น ส่งผลให้อันตรกิริยาแบบ AFC ที่เกิดขึ้นระหว่างชั้น FePd และ CoFe มีความแรงที่อ่อนลง สำหรับที่อุณหภูมิ 813 K นั้น การที่ชั้นโลหะผสม FM ทั้งสองมีสมบัติทางแม่เหล็กแบบเฟอร์โรชนิกแข็งที่สูงและมีความใกล้เคียงกัน ทำให้ระบบ QW ที่ไม่เสถียรในชั้น Ru ไม่สามารถผลักดันให้แมgnนิติไซเซชันของชั้น FePd และชั้น CoFe มีทิศทางที่สวนทางกัน ได้อันตรกิริยาแบบ AFC จึงไม่เกิดขึ้นในฟิล์มตัวอย่างที่สภาวะดังกล่าว แต่ปรากฏอันตรกิริยาแบบ FC ขึ้นแทน

แต่เมื่อพิจารณาการให้ความร้อนกับฟิล์มตัวอย่าง FePd/Ru/CoFe ในงานวิจัยนี้ พบว่า เป็นการให้ความร้อนที่อุณหภูมิสูง ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่พลังงานความร้อนดังกล่าวมีค่าสูงพอที่จะ ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของอะตอนบริเวณรอยต่อระหว่างชั้นฟิล์ม จากงานวิจัยของ Wang, Xu, Liang, and Zhangs (2011) พบว่า เกิดการแพร่กระจายของอะตอนบริเวณรอยต่อระหว่างชั้นฟิล์ม FePt และ Ru ขึ้นในฟิล์มบางแบบ 3 ชั้น FePt/Ru/Fe ที่ผ่านกระบวนการให้ความร้อนที่สภาวะ อุณหภูมิ 823 K และเนื่องจาก FePt และ FePd มีลักษณะทางโครงสร้างที่เหมือนกัน แต่ FePd มี อุณหภูมิของพลังงานความร้อนที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของอะตอนในโครงสร้างผลึกที่ต่ำกว่า FePt อาจ มีผลทำให้ ฟิล์มตัวอย่าง FePd/(30 nm)/Ru/(0.8 nm)/CoFe(12 nm) ที่ผ่านการให้ความร้อนไปจนถึง อุณหภูมิ 613 K, 733 K และ 813 K นั้น เกิดการแพร่กระจายของอะตอนบริเวณรอยต่อระหว่างชั้น ฟิล์ม FePd และ Ru ขึ้น และทำให้ความหนาของชั้น Ru ลดลง ในขณะเดียวกัน จากผลงานวิจัยที่

การศึกษาพฤติกรรมของการเกิดอันตรกิริยาแบบ AFC ในฟิล์มตัวอย่าง FePd(30 nm)/Ru(0.8 nm)/CoFe(12 nm) ด้วยการวัด GMR แบบ CIP นั้น แสดงผลอยู่ในรูปของค่า MR% ดังภาพที่ 48 จากการวิเคราะห์พบว่า ในสภาวะที่ขนาดของ H มีค่าสูงนั้น M_1 และ M_2 ของชิ้นงานตัวอย่าง มีพิษทางเดียวกัน ทำให้อิเล็กตรอนตัวนำที่เคลื่อนที่เข้าสู่ชิ้นงานตัวอย่างมีการกระเจิงที่ต่ำ ส่งผลให้ค่าความต้านทานไฟฟ้าของชิ้นงานที่วัด ได้มีค่าน้อย และเมื่อลดขนาดของสนาม H ลง พบว่าค่าความต้านทานไฟฟ้าของชิ้นงานมีค่าใกล้เคียงกับค่าเดิมและเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ เนื่องจากการบิดตัวกลับของ M_1 เพียงเล็กน้อย แต่ในสภาวะที่สนามแม่เหล็กที่จ่ายใหกับชิ้นงานมีค่าต่ำ พบว่าค่าความต้านทานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากการบิดตัวกลับอย่างฉับพลันของ M_1 ซึ่งเกิดจากอันตรกิริยาแบบ AFC ที่เกิดขึ้นระหว่างชั้น FePd และ CoFe โดยทำให้ M_1 มีพิษทางการวางแผนตัวที่ตรงกันข้ามกับพิษของ M_2 การส่วนทางกันของแมgnิโตเซ็นทรัลทั้งสอง ทำให้อิเล็กตรอนตัวนำที่ผ่านเข้าไปในฟิล์มตัวอย่างมีการกระเจิงที่สูงขึ้น ส่งผลให้ความต้านทานไฟฟ้าของชิ้นงานมีค่าเพิ่มขึ้น และเมื่อลดการจ่ายสนามแม่เหล็กลงจนถึง 0 mT พบว่าฟิล์มตัวอย่าง FePd(30 nm)/Ru(0.8 nm)/CoFe(12 nm) ที่เตรียมได้ท่ออุณหภูมิห้อง และที่ผ่านกระบวนการให้ความร้อนไปจนถึงอุณหภูมิ 613 K และ 733 K นั้น มีค่า MR% สูงที่สุดและมีค่าใกล้เคียงกัน เท่ากับ 0.24% (AP), 0.26% (613 K) และ 0.28% (733 K) ตามลำดับ สำหรับในส่วนของฟิล์มตัวอย่างที่ผ่านกระบวนการให้ความร้อนไปถึงอุณหภูมิ 813 K นั้น พบว่าค่า MR% สูงสุดอยู่ที่ 0.17% ซึ่งมีค่าต่ำแตกต่างจาก MR% ของชิ้นงานตัวอย่างที่สภาวะอุณหภูมิอื่น ๆ โดยสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์สมบัติทางแม่เหล็กที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งระบุว่าอันตรกิริยาแบบ AFC จะปรากฏขึ้นในฟิล์มตัวอย่าง FePd(30 nm)/Ru(0.8 nm)/CoFe(12 nm) ที่เตรียมได้ท่ออุณหภูมิห้อง และที่ผ่านกระบวนการให้ความร้อนไปจนถึงอุณหภูมิ 613 และ 733 K แต่จะถูกทำให้สลายไป เมื่อให้ความร้อนไปจนถึงอุณหภูมิ 813 K